論文

Al-1% Mn 合金の熱間加工で形成する析出物とその分散状態*

田中 宏樹**, 佐々木 勝寛**

Formation and Dispersion of Precipitates during Hot Deformation in Al-1%Mn Alloys*

Hiroki Tanaka ** and Katsuhiro Sasaki **

In this study, precipitation behavior in hot workings on Al-1%Mn alloy was investigated. It has been identified specimens used in this study show thermally stabilized substructures after plain strain compression (PSC) test as a hot working. PSC tests were carried out between 300°C and 500°C. By using small angle x-ray scattering (SAXS) method, dispersion state of precipitations formed in hot workings were estimated. It was considered minute precipitations less than 10 nm in diameter were formed in hot worked areas. These minute precipitations were increased with increasing in compression temperature. In invariant area heated at 400°C, precipitations less than 10 nm were not identified. By using of HAADF-STEM, these minute precipitations less than 10 nm were confirmed, and it was cleared due to EDS analysis the precipitations consist of four elements such as aluminum, manganese, iron and silicon.

Keywords: aluminum manganese alloys, plain strain compression, small angle x-ray scattering, high angle annular dark field scanning, hot deformation

1. 緒 言

一般に、アルミニウム合金展伸材を高温で加熱する と等軸の再結晶粒組織となり強度低下が生じる。熱間 加工時に熱的安定な下部組織を形成させることで加熱 後も繊維状組織が維持され、高い強度と靭性を確保で きる¹⁾ことや耐食性の改善効果^{2),3)}が知られている。遷 移元素のマンガンを主要添加元素とする3000系アルミ ニウム合金は缶ボディ材等に広く使われていて、その 再結晶挙動を制御することは重要な課題である。これ までの研究では、均質化処理条件を変えることで第二 相粒子の分散状態を変化させ、その後の熱間加工組織 における回復挙動を調査している^{4),5)}。熱間加工中に 生じる析出挙動も熱的安定な下部組織形成に影響する と考えられるが、調査例が少なく不明な点が多い。

筆者らは高純度(4Nベース)地金と99.5%(1050ベース)地金にマンガンを1%添加した供試材を準備して, 平面ひずみ圧縮(PSC)試験⁶により,熱的安定な下部 組織形成条件を調査した⁷⁾。この試験では均質化処理 を行わず,熱間圧縮時に生じる析出挙動の影響を明ら かにすることを目的とした。その結果,4Nベース合金 では,PSC試験後の導電率変化が小さく,析出は少な いと判断した。1050ベース合金は圧縮部の導電率が上 昇し,非圧縮部よりも析出が促進すると判断した。 PSC試験後に500℃熱処理(ソルトバス)を行うと4N ベース合金は再結晶するが,1050ベース合金は再結晶 せず,熱的安定な下部組織形成状態に有意差が認めら れた。

本研究では1050ベース合金の高温圧縮部に形成する 析出状態を明らかにすることを目的とした。圧縮部に 形成する析出物は非常に微細であると考え,X線小角 散乱法 (Small Angle X-ray Scattering, SAXS)⁸⁾での調 査を行った。小角散乱の回折強度プロファイルを解析 することで、ナノメートルサイズの粒子分布を推定で きる。

^{*} 本稿の主要部分は,軽金属,71 (2021),549-554 に掲載。

The main part of this paper was published in Journal of The Japan Institute of Light Metals, **71** (2021), 549-554. ** (株) UACJ R&D センター 第一研究部,博士 (工学) Research Department I, Research & Development Division, UACJ Corporation, Dr. Eng.

2. 実験方法

本研究に用いたアルミニウム合金の成分をTable 1 に示す。一般的な半連続鋳造により一辺が175mm幅 の鋳塊を造塊した。この鋳塊から厚さ10mm,幅 20 mm, 長さ50 mmの試験片を調製した。なお, 熱間 加工中の溶質元素の析出挙動を明らかにするため、こ れらの鋳塊に均質化処理は行わなかった。これは、均 質化処理で形成する析出物と熱間加工中に形成する析 出物の混在を避けるためである。PSC試験条件は前報 ⁷⁾で報告した通りで,その処理方法をFig.1(a)に示す。 300℃, 400℃および500℃の温度で厚さ5 mmまで圧 縮を行った。ひずみ速度は1s⁻¹とした。導電率の測定 位置をFig.1 (b)に示す。 圧縮部の中心部(Constriction area)と非圧縮部の表層 (Invariant area) で測定した。 微細化合物の分散状態を小角散乱法⁸⁾で調査した。小 角散乱測定はあいちシンクロトロン放射光で実施し た。その測定条件をTable 2に示す。小角散乱強度は 測定サンプルの厚さの影響を受けるため、本報では測 定値をサンプル厚さで除した値で比較した。測定に使 用したサンプルの厚さをTable 3に示す。小角散乱強 度プロファイルは解析ソフトIrenaを用いて微細化合 物の分散状態を解析した⁹⁾。散乱ベクトル (Q) は (1) 式 で,小角散乱強度*I*(*Q*)は(2)式で示される¹⁰⁾。本報で は化合物の形態を球状と仮定し、サイズ分布関数とし

Table 1 Chemica	l composition	of specimens	(mass%).
-----------------	---------------	--------------	----------



(b) Specimen appearance after PSC

Fig. 1 Experimental procedures on (a) heating pattern of PSC test and (b) measurement arias of the specimens.

て対数正規分布を用いた。Irenaでは,球体の半径*Rを*変化させた粒度分布 (P)を求めて (2) 式から小角散乱強度を計算して実測値にフィッティングさせ,化合物の分散状態を推定する。

$$Q=4\pi\sin\theta/\lambda\tag{1}$$

ここで、 θ は散乱角、 λ はX線波長を示す。

$$I(Q) = \rho^2 \int_0^\infty F^2(Q) N(R) dR$$
 (2)

ここで、 ρ は電子密度、F(Q)は試料からの散乱X線の振幅、N(R)は半径Rの粒子数を示す。

PSC試験後の析出状態を確認するため,HAADF-STEM (High-Angle Annular Dark Field Scanning TEM) 観察を行った。この観察像は透過電子のうち高 角に散乱したものを環状の検出器で検出することによ り得られ,原子量の大きい元素を含む場合に明るいコ ントラストが得られる¹¹⁾。観察は FEI 製 Tecnai Osiris で、加速電圧 200 kV で行った。EDS分析はSTEMプ ローブ径を1 nm以下とした。

3. 実験結果

3.1 導電率

導電率の測定結果をTable 4に示す。非圧縮部より 圧縮部の方が導電率は高く,圧縮部でより多く析出し ていることが推察できる。PSC温度が高いほど,圧縮 部の導電率は高くなる。非圧縮部は、300℃加熱では as cast 状態の導電率と同じであるが、500℃加熱では 導電率の上昇が確認できる。PSC試験条件から、約0.5 秒の圧縮加工時間で析出が生じていると推定できる。

Table 2Measurement method of
Aichi synchrotron radiation.

	-
Beam line	BL8S3
Analysis method	SAXS
Detector	R-AXIS
Aperture	2.5mm
Camera length	1126.09mm
WAVE LENGTH	0.92 Å

Table 3Specimen thickness on
SAXS measurement (mm).

Invariant area	Constriction area					
400 °C	300 °C	400 °C	500 °C			
0.455	0.336	0.474	0.356			

 Table 4
 Difference on electrical conductivity between invariant and constriction areas (%IACS).

as cast	In	variant ai	ea	Constriction area				
	300 °C	400 °C	500 °C	300 °C	400 °C	500 °C		
30.5	30.5	30.6	31.1	30.9	31.1	31.5		

3.2 小角散乱

100

10

1

0.1

Fig. 2に測定した小角散乱強度を示す。X軸は散乱 ベクトル (Q) を示す。Q値が0.2以下で散乱強度が低下 しているのは、検出器を保護する目的でスクリーン遮



Scattering vector, Q / nm⁻¹ (b) Constriction area at 300, 400 and 500°C

1



蔽しているためである。まず400℃での圧縮部, 非圧 縮部の状態 (Fig. 2 (a)) を比較すると、 Q値が0.2から1. 0の範囲で曲線の傾きが異なることがわかる。非圧縮 部の傾きが圧縮部より大きくなっている。次に圧縮部 の状態 (Fig. 2 (b)) を比較する。300 ℃圧縮部と400 ℃ 圧縮部の散乱強度は近い傾きを持った曲線となってい る。500℃圧縮部はQ値が1.0以上で400℃圧縮部と 300℃圧縮部の間の強度を示し、他の条件とは異なる 曲線形状といえる。

小角散乱強度の実測値とフィッティングさせるため に決定したIrenaでの各係数をTable 5に示す。Scale は強度, Min size は対数正規分布の定数, Mean は確立 変数の期待値(平均), Std dev.は標準偏差を示す。400 ℃非圧縮部は一つの粒度分布 (1P) で実測値とフィッテ ィングができた。圧縮部は複数の粒度分布(2P, 3P)を 合計して実測値にフィッティングさせる必要があっ た。Fig. 3に小角散乱強度の実測値とIrenaでモデル計 算してフィッティングした結果を示す。いずれの条件



Fig. 3 Experimental and calculated values on SAXS data (a) invariant at 400 $^\circ\!\! C$, (b) constriction at 400 $^{\circ}$ C, (c) constriction at 300 $^{\circ}$ C and (d) constriction at 500 $^\circ \!\!\! \mathbb{C}$.

	1P			2P			3P					
	Scale	Min size [Å]	Mean [Å]	Std.dev.	Scale	Min size [Å]	Mean [Å]	Std.dev.	Scale	Min size [Å]	Mean [Å]	Std.dev.
300 ℃ constriction	3.2972	9.5014	214.994	0.2822	1.0796	13.2065	2.8226	3.0972				
400 ℃ constriction	5.3089	14.5058	243.356	0.2801	0.8482	14.9599	0.3004	3.0338				
$500 \ ^{\circ}{ m C}$ constriction	2	38	330	0.4964	1.8085	8.5	0.2793	3.1331	15	2.041	565.444	0.3856
400 ℃ invariant	10.9362	39.9475	217.509	0.3466								

Table 5 Setting factors on Irena analysis.

10

も Irena で適切なパラメータを設定することで良好な フィッティング状態が得られている。この結果から化 合物の分散状態を予測した結果を**Fig.** 4に示す。横軸 は化合物の半径でナノメートル (nm) 表示をしている。 縦軸は体積率を示している。化合物の粒度分布 (1P) を 点線で示し、複数の粒度分布が想定された場合 (2P, 3P) はその合計を実線で示している。400 ℃非圧縮部 (Fig. 4 (a)) は25 nm付近にピークのある分散状態を示 す。一方、400 ℃圧縮部 (Fig. 4 (b)) は25 nm付近と 3 nm付近の2 つのピークを持つ分散状態となってい る。300 ℃圧縮部 (Fig. 4 (c)) は400 ℃圧縮部 としつかあり、30 nm付近に小さなピークおよび 50 nm付近にもピークが認められる。3nm付近のピー クは圧縮部のみで認められ、その体積率は300℃圧縮部 <400℃圧縮部<500℃圧縮部の順に大きくなる。

3.3 STEM 観察

Fig. 4 で推定した微細化合物の状態をHAADF-STEMで確認した。Fig. 5にHAADF-STEM像を示 す。400℃圧縮部(Fig. 5 (b))には40 nm程度の化合物 と10 nm以下の微細化合物が認められる。400℃非圧 縮部(Fig. 5 (a))には, 10 nm以下の微細化合物は確認 できなかった。300℃圧縮部(Fig. 5 (c))にも400℃圧 縮部と同様に40 nm程度の化合物と10 nm以下の微細 化合物が認められる。500℃圧縮部(Fig. 5 (d))には50 ~100 nm程度のサイズを有する化合物が認められる。



Fig. 4 Size distributions of precipitations derived from SAXS profiles in Fig. 3 (a) invariant at 400 $^{\circ}$ C, (b) constriction at 400 $^{\circ}$ C, (c) constriction at 300 $^{\circ}$ C and (d) constriction at 500 $^{\circ}$ C.



(a) Invariant at 400°C

(b) Constriction at 400°C





(c) Constriction at 300°C

(d) Constriction at 500°C

Fig. 5 STEM images after PSC test (a) invariant at 400 °C, (b) constriction at 400 °C, (c) constriction at 300 °C and (d) constriction at 500 °C.

Fig. 4 (d)に示す500℃圧縮部には10 nm以下の化合物 も存在することが予想される。Fig. 5 (d)の一部を拡大 した状態をFig.6に示す。500℃圧縮部にも10 nm以下 の微細化合物が存在している。Fig. 5 (d)内に, このよ うな微細化合物の集まりが複数個所確認できる。 HAADF-STEM像で確認できる化合物に対して, EDS 分析で構成元素を確認した。Fig. 7に400℃圧縮部の HAADF-STEM像とEDS分析結果を示す。確認できる 微細化合物はAl-Mn-Fe-Si系四元化合物であった。300 ℃および500 ℃ 圧縮部にみられる化合物も Al-Mn-Fe-Si 系四元化合物であった。HAADF-STEM像で確認でき る微細化合物の形成過程を次のように考える。所定温 度に加熱(1分),保持(1分)中に10nm以上の化合物が 形成し、PSC試験中にそれらが成長することと、新た に10 nm以下の化合物が形成する。500℃圧縮では化 合物の成長速度が速く、PSC 直前までに形成した化合 物の多くがPSC 試験中に50~100 nm 程度のサイズまで 成長することと、新たに10nm以下の化合物が形成し、 Fig. 4 (d)で示す分散状態になった。これらの形態を考 慮すると、PSCを行った熱間加工中の析出は、熱間加 工前に形成していた化合物の周囲に析出する場合と, 新たに微細析出する場合の二通りがあることが分かっ た。



Fig. 6 STEM images (a) constriction at 500℃ and (b) courtesy image of the broken line area in the left image.



Fig. 7 STEM-EDS analyses on the constriction area at 400 $^\circ\!\! C$.

4. 考察

PSC試験の圧縮部で導電率が高くなる(析出する)場 合,熱的安定な下部組織が形成することを前報⁷⁾で報 告し,**Fig.8**に示すメカニズムを提案した。加工中に 移動する転位に析出が生じて転位の移動が抑止され,



Fig. 8 Hypothesis on the formation of thermally stabilized substructures. a: lattice constant.

別なすべり面を移動する転位と反応した場合に不動転 位化することで,熱的安定な下部組織が形成すると考 えた。異なる {111} 面にある2個の転位の反応はローマ ー固着 (Lomer lock) 機構として知られ,不動転位化す る現象として提案されている¹²⁾。また,HAADF-STEMで観察した10 nm以下の化合物は粒界にも析出 して,粒界の移動を抑止して再結晶を抑制するように 作用したものと考えられる。

熱間加工中の析出物を同定するため、前報⁷⁾では400 ℃非圧縮部と圧縮部のXRD測定(測定波長:0.8692Å) を行った。その結果を**Fig.9**に示す。特徴的な点とし て、2 θ =26.5°の回折強度が非圧縮部より圧縮部で増加 していることである。この回折はAl₆Mn₂Si₅の析出によ るものと考えた。STEM-EDS分析ではAl-Mn-Si系三元 化合物は観察できず,Al-Mn-Fe-Si系四元化合物であっ た。再度,本回折ピークの形成要因を検討したところ, 2 θ =26.5°の回折ピークはAl₉Fe_{0.84}Mn_{2.16}Siの(220)面の 回折ピークとほぼ重なることがわかった¹³⁾。Fig.9に Al₉Fe_{0.84}Mn_{2.16}Siの回折ピーク位置を追記した。

これらのことから, Al-1%Mn合金の熱間加工で形成 する析出物はAl-Mn-Fe-Si系四元化合物と考える。今 後,鉄及びケイ素の存在量を変化させ,熱間加工中の 析出挙動や熱的安定な下部組織形成への影響について 調査する予定である。

5. 結 言

Al-1%Mn合金をPSC試験で熱間圧縮した部位の析出 状態を調査し、以下の結果を得た。

- (1)PSC試験温度が高いほど, 圧縮部の導電率は高く なる。非圧縮部も500℃加熱では導電率の上昇が 認識できるが, 圧縮部の方が導電率の上昇は大き い。PSC試験条件から,約0.5秒の圧縮加工時間で 析出が生じていると推定できる。
- (2)小角散乱強度プロファイルの解析から、圧縮部に



Fig. 9 X-ray diffractograms derived from the PSC specimens heated at $400 \,^\circ \text{C}$.

は10 nm以下の微細化合物が存在することがわか る。この微細化合物は300 ℃圧縮部<400 ℃圧縮 部<500 ℃圧縮部の順に多くなる。非圧縮部には, 10 nm以下の微細化合物は確認できない。

(3)STEM-EDS分析から, 圧縮部で認識できる10 nm 以下の微細化合物はAl-Mn-Fe-Si系四元化合物で ある。

謝辞

本成果の一部は「冷間/熱間加工工程における組織形 成予測部会」により得られたものです。関係者各位に深 く感謝申し上げます。XRD解析はトヨタ自動車株式会 社(元UACJ)・立山真司博士の協力を得ました。 STEM観察は産業技術総合研究所・齋藤徳之氏の協力 を得ました。ここに感謝申し上げます。

参考文献

- 1) 鈴木太一,八太秀周:日本国特許第6291133号
- H. Tanaka, Y. Nagai, Y. Oguri and H. Yoshida: Materials Transactions, 48(2007) 2008-2013. doi.org/10.2320/ matertrans.L-MRA2007872
- H. Tanaka and Y. Nagai: Proc. 15th Int. Conf. on Aluminum Alloys, (Trans Tech Publications, 2017) pp. 281-289.

- 3. (1989), 土公武宜, 八木啓介: 軽金属, 39 (1989), 94-100.
 doi.org/10.2464/jilm.39.94
- 5) 箕田正, 吉田英雄: 軽金属, 47 (1997), 691-695. doi.org/ 10.2464/jilm.47.691
- 6) 田中宏樹,長井康礼:軽金属, 66 (2016), 2-8. doi.org/ 10.2464/jilm.66.2
- 7)田中宏樹,成田渉:軽金属, 69 (2019), 393-397. doi.org/ 10.2464/jilm.69.393
- 8) 松岡秀樹:日本結晶学会誌, 41 (1999), 213-226. doi.org/ 10.5940/jcrsj.41.213
- 9) J. Ilavsky and P. R. Jemian: Journal of Applied Crystallography, 42(2009), 347-353. doi.org/10.1107/ S0021889809002222
- 10) 山崎悟志,大場洋次郎,佐々木宏和,大沼正人:古河電工時 報,137 (2018),46-51.
- 齋藤晃:日本結晶学会誌, 47 (2005), 9-14. doi.org/10.5940/ jcrsj.47.9
- 12) 中村正久:基礎転位論, 丸善株式会社, (1981), 90-92.

13) R. A. Brand, G. L. Caër, J. M. Dubois, F. Hippert, C. Sauer and J. Pannetier: J. Phys. Condens. Matter 2 (1990) 3855-3865.



田中 宏樹(Hiroki Tanaka) (株)UACJ R&D センター 第一研究部 博士 (工学)



佐々木 勝寛 (Katsuhiro Sasaki) (株)UACJ R&D センター 第一研究部 博士 (工学)